

# SPUTTER GROUP

## 濺鍍機系統

# ULVAC

---日本優貝克---

CONDUCTING

導電薄膜



# KD

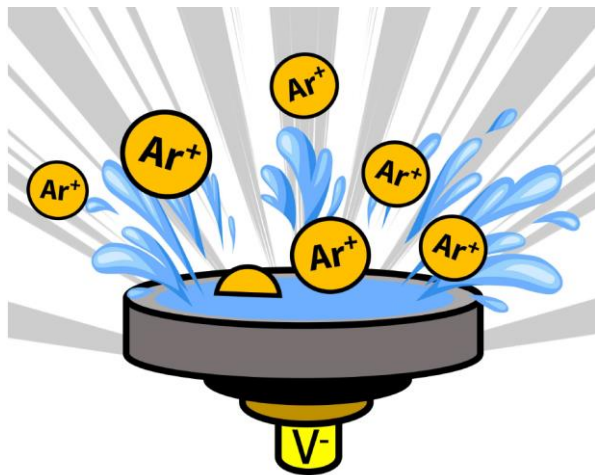
---台灣高敦---

DIELECTRIC

介電材料

### 鍍膜理論 THEORY

濺鍍機屬於物理性沉積系統，利用氬氣產生氬離子電漿，並透過RF或DC在靶材區形成負電位，讓帶正電的氬離子撞擊靶材表面而濺射出材料源，進而在基板表面進行薄膜之鍍製。



### 系統條件比較 CONDITION

#### ➤ ULVAC 日本優貝克



- ◆ 最大樣品尺寸：4吋
- ◆ DC 電子槍 × 2 支
- ◆ 靶材尺寸：2吋

#### 靶材種類

- ✓ Al
- ✓ Ni
- ✓ Ti
- ✓ Ag
- ✓ W
- ✓ Mo

#### ➤ KD 台灣高敦

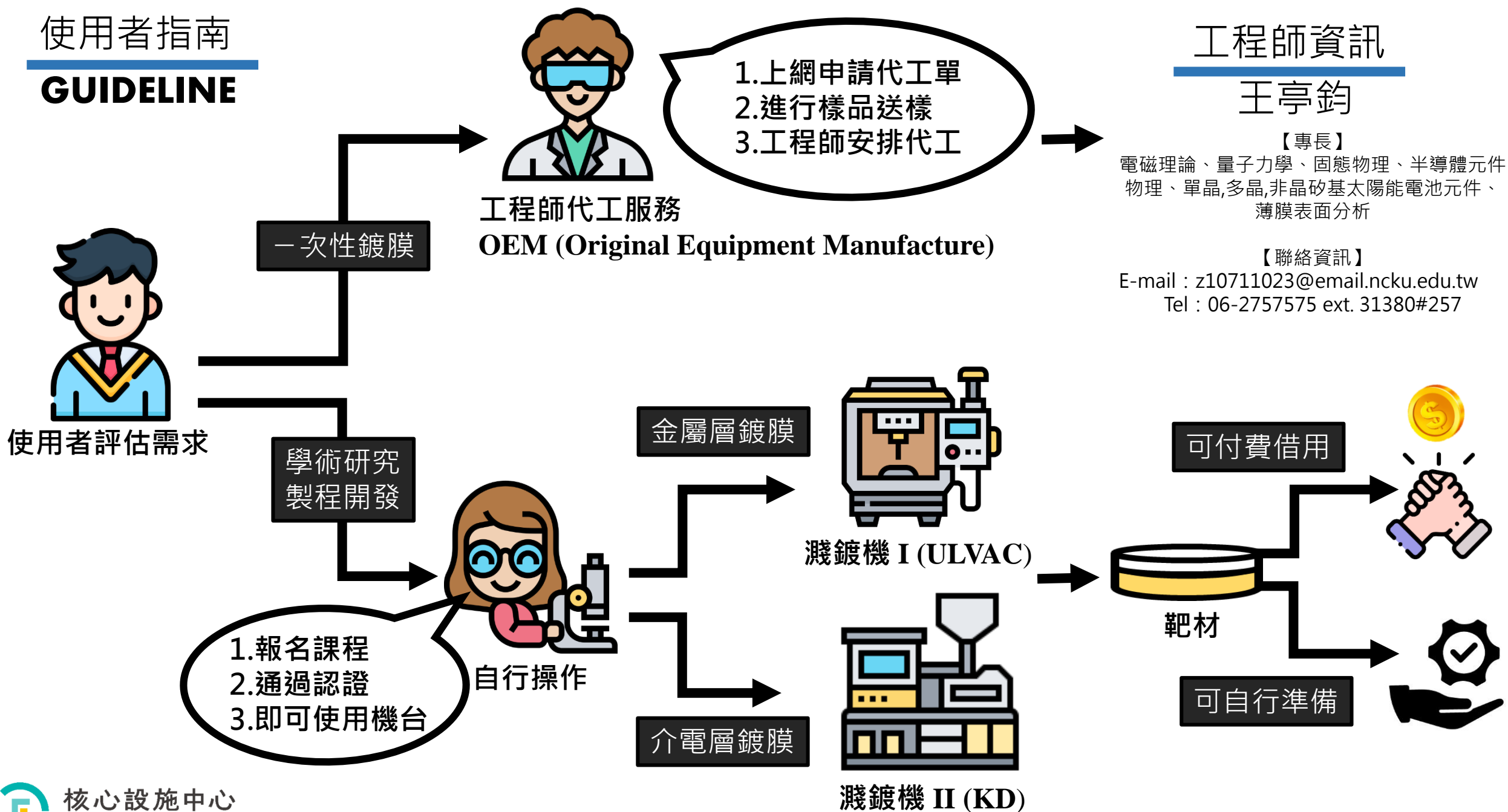


#### 靶材種類

- ✓ SiO<sub>2</sub>
- ✓ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
- ✓ HfO<sub>2</sub>
- ✓ TiO<sub>2</sub>
- ✓ ITO

- ◆ 最大樣品尺寸：6 吋
- ◆ DC 電子槍 × 1 ; RF 電子槍 × 1
- ◆ 靶材尺寸：3 吋

# 使用者指南 GUIDELINE



# 費用總表

## Fee Payment



### 儀器系統費用

	自行操作	代工	[備註]
濺鍍機 I (ULVAC)	學界：1,150 NTD/ hr 業界：1,750 NTD/ hr	學界：2,000 NTD/ hr 業界：3,050 NTD/ hr	靶材費用另計 請參閱靶材費率表
濺鍍機 II (KD)			
[ 課程費 ]：(1) 學界 4,000 NTD (2) 業界 7,600 NTD [ 認證費用 ]：(1) 學界 1,600 NTD (2) 業界 2,800 NTD			



### 靶材租借費用

Al	Ti	Ni	Mo	Ag	W
鋁	鈦	鎳	鉬	銀	鎢
300 NTD	500 NTD	500 NTD	800 NTD	500 NTD	800 NTD

SiO <sub>2</sub>	TiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	HfO <sub>2</sub>	ITO	TiN	AZO
二氧化矽	二氧化鈦	氧化鋁	氧化鈦	氧化銦錫	氮化矽	氧化鋁鋅
600 NTD	800 NTD	800 NTD	1200 NTD	800 NTD	1000 NTD	800 NTD

[ 註 ] 靶材借用以1天24小時為單位，若逾時歸還，則視同續借，持續累計計價。

# 問答專區

## Q&A



< 優柔寡斷的同學



您好，請問更換靶材的方式  
可以請工程師說明嗎？

22:05



濺鍍機台課程教育訓練，即包含完整靶材更換教學，待訓練完成通過認證，使用者即可自行預約機台時間，並進行靶材之更換。其費率方面也將與一般正常機台使用有所區別，更換靶材時段其費用較為便宜。

已讀  
22:15



感謝，那我再花一學期好好想想該換什麼靶材好。

22:20

< 可能被蝙蝠咬過的同學



請問機台開放的時段？

03:32



濺鍍機系統基本上是1年12個月，每天24小時全面開放。除了每週五下午兩個小時的機台PM例行保養時間，定期保養的目的為將確保系統機構正常運作及維持腔體潔淨度，讓使用者在鍍膜製程上維持穩定度。

已讀  
03:35



那我都要半夜做實驗

03:40



已讀  
03:42

你有這麼見不得光？